

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成29年3月30日(2017.3.30)

【公開番号】特開2016-28038(P2016-28038A)

【公開日】平成28年2月25日(2016.2.25)

【年通号数】公開・登録公報2016-012

【出願番号】特願2015-160176(P2015-160176)

【国際特許分類】

C 07 D 261/20 (2006.01)

C 07 H 9/04 (2006.01)

C 07 H 19/24 (2006.01)

【F I】

C 07 D 261/20 C S P

C 07 H 9/04

C 07 H 19/24

【誤訳訂正書】

【提出日】平成29年2月22日(2017.2.22)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】請求項9

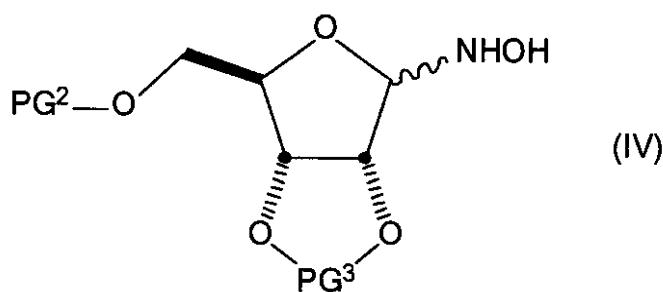
【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【請求項9】

以下の式の (1S,4R)-3-(1-C-ハロ-D-リボフラノシリル)-2-オキサ-3-アザビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン：

【化4】



式中、

Xは、フッ素、塩素、臭素およびヨウ素から選択されるハロゲン原子であり；

PG²は、メトキシメチル、ベンジルオキシメチル、トリフェニルメチル、トリメチルシリル、トリエチルシリル、トリイソプロピルシリル、アセチル、ベンゾイル、メタンスルホニル、p-トルエンスルホニルおよびN-フェニルカルバモイルからなる群から選択され、前記トリフェニルメチルは、非置換であるか、そのフェニル基にC₁₋₄アルキル基およびハロゲン原子からなる群から選択される1つ以上の置換を有し；

PG³は、メチレン、エチリデン、イソプロピリデン、シクロペンチリデン、およびシクロヘキシリデンから選択される。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0014

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0014】

ヒドロキシル保護基PG²は、本発明の方法の条件下またはニトロソリボフラノシルハライド(II)の合成の間に切断されないいづれかの基であってよい。本発明の方法は、PG²の切断を含まないため、PG²が容易におよび／または選択的に切断され得る必要はない。適切なヒドロキシル保護基は、リボース分子のC-5におけるヒドロキシ基と共に、エーテル(シリルエーテルを含む)またはエステル(カルボン酸、炭酸、スルホン酸およびアルキル-もしくはアリール-カルバミン酸のエステルを含む)部分を形成するものである。エーテルは、メチルもしくは置換メチル(例えば、メトキシメチル、ベンジルオキシメチルもしくはトリフェニルメチル)エーテルのようなアルキルエーテル、またはトリアルキルシリル(例えば、トリメチルシリル、トリエチルシリルもしくはトリイソプロピルシリル)エーテルのようなシリルエーテルであってよい。エステルは、例えば、アセテートもしくはベンゾエートのような単純なアルカンもしくはアレーンカルボン酸のエステル、またはメタンスルホネート(メシレート)もしくはp-トルエンスルホネート(トシレート)のようなアルカン-またはアレーンスルホン酸のエステル、またはN-フェニルカルバメートのようなN-アリールカルバミン酸のエステルであってよい。これらおよび他の保護基ならびにそれらを導入するための適切な方法は、当業者に既知であるか、またはGreene's Protective Groups in Organic Synthesis by Peter G. M. Wuts and Theodora W. Greene, John Wiley & Sons, Hoboken, NJのような周知のテキストおよび研究論文において見出される。